



オックスフォードアプライドリサーチ社製品

表面科学・ナノサイエンス研究用機器製品

オックスフォードアプライドリサーチ社は薄膜成膜のためのUHV、HVコンポーネントを提供しています。

- ◆ ミニ e-ビームエバポレータ
- ◆ サーマルガスクラッカー
- ◆ ピエゾエレクトリックガスドーズーザー PLV1000
- ◆ RF アトムソース
- ◆ 低コスト イオンソース IG5
- ◆ 低エネルギーイオンソース LIon50
- ◆ ナノクラスターソース
- ◆ オーガニックエバポレータ
- ◆ 各種イオンソース

三和真空株式会社



オックスフォードアプライドリサーチ社製品

ミニ e-ビームエバポレータ

ミニ e-ビームエバポレータ EGシリーズは高純度膜の作製に適しており、蒸着レートは高度な制御が可能で、多くの材料に対して0.1~50 Å/minの範囲でコントロール出来ます



用途

- 数nmの薄膜作製、半導体ドーピング

特徴

- 冷却効率でコンタミネーションフリーの設計
- 材料はロッドまたはルツボ充填の選択
- 標準搭載のフラックスモニタリングプレートにより精密な膜厚コントロールが可能
- 1、4ポケットのタイプ 4ポケットタイプは各ポケットの独立制御で同時蒸着も可能なタイプあり

サーマルガスクラッカー

TCシリーズサーマルガスクラッカーは電子ビーム加熱技術を利用し、ガス分子を低パワーで効率よく解離させるユニットです



用途

- "ソフト"基板クリーニング
- 酸化物、窒化物
- 表面活性
- ゼロダメージ水素クリーニング
- H、O、N、NH₃

特徴

- 高い解離効率
- 超クリーンオペレーション
- 非常に低いパワー(<60W)
- バックアップフィラメント標準装備
- 低メンテナンス

piezoelectric gas doser PLV1000

UHVの装置に適合したオールメタルの極微量リークバルブで内蔵された圧電素子を用いて制御されます



用途

- 極微量ガス導入
- MBEガス導入
- ガスパルシング
- システム圧力コントロール

特徴

- リモートコントロール
- オールメタル
- 極微量コントロール
- PCコントロール

三和真空株式会社



オックスフォードアプライドリサーチ社製品

RF アトムソース

RF アトムソースはRF放電を利用した中性ビームの発生源で、極めて高い原子フラックスとイオン量ゼロの中性ビームを生み出します



用途

- 窒化物、酸化物
- N-ドーピング
- High-K誘電体
- 水素原子クリーニング

特徴

- 高解離率
- 高品質膜
- 均一性

低コスト イオンソース IG5

IG5は低いガス流量レートで作動する冷陰極イオン源で、イオンクリーニング、スパッタリングアプリケーションに理想的です



用途

- イオンクリーニング
- スパッタリングアプリケーション

特徴

- ビームエネルギー 1.0 - 5.0 keV
- 低いガス流量
- フィラメントフリー

低エネルギーイオンソース LIon50

低エネルギーイオンソース LIon50は電子衝撃を利用した低エネルギーガスイオンソースです



用途

- 基板クリーニング
- 表面改質
- エッチング

特徴

- ビームエネルギー 30 eV - 1 keV
- 狭いエネルギー幅
- O₂のような活性ガスにも対応

ご注文、お問合せ先

三和真空 株式会社

〒143-0013 東京都大田区大森南4-6-15 テクノ FRONT 森ヶ崎307

TEL:03-5735-5656 FAX:03-5735-5655

URL:<http://www.sanwa-vacuum.co.jp>